

利用料金表(消費税込み)

東京大学微細構造解析プラットフォーム

H29. 4. 1改定

■ TEM/STEM

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
環境対応型超高分解能電子顕微鏡(Cs-STEM)JEM-ARM200F Cold FE double SDD (日本電子)	PF	1日	60,000	機器利用	1	60,000	—
				技術支援	2	120,000	
				技術代行	5	300,000	
原子分解能元素マッピング構造解析装置(Cs-STEM)JEM-ARM200F Thermal FE single SDD(日本電子)	PF	1日	30,000	機器利用	1	30,000	—
				技術支援	2	60,000	
				技術代行	5	150,000	
軽元素対応型超高分解能走査透過型電子顕微鏡(Cs-STEM)JEM-ARM200F Cold FE(日本電子)	PF	1日	36,000	機器利用	1	36,000	—
				技術支援	2	72,000	
				技術代行	5	180,000	
透過/走査型分析電子顕微鏡JEM-2800(TEM/STEM)	PF	1日	22,000	機器利用	1	22,000	—
				技術支援	2	44,000	
				技術代行	5	110,000	
超高分解能透過型電子顕微鏡(Cs-TEM)JEM-ARM200F Thermal FE(日本電子)	PF	1日	30,000	機器利用	1	30,000	—
				技術支援	2	60,000	
				技術代行	5	150,000	
クライオ透過型電子顕微鏡(Cryo-TEM/STEM)JEM-2100F(日本電子)	PF	1日	20,000 クライオは+5,000 EDS,EELSは+2,000	機器利用	1	本体単価×1+加算分	クライオサンプル調製費用:1,000円/2時間/1単位,初期講習は有料(技術支援相当額を請求)
				技術支援	2	本体単価×2+加算分	
				技術代行	5	本体単価×5+加算分	
有機材料ハイコントラスト電子顕微鏡(Bio-TEM)JEM-1400(日本電子)	PF	0.5日	4,000	機器利用	1	4,000	—
				技術支援	2	8,000	
				技術代行	5	20,000	
原子直視型超高压電子顕微鏡JEM-ARM1250(日本電子)	PF	1日	50,000	機器利用	1	50,000	—
				技術支援	2	100,000	
				技術代行	5	250,000	
高分解能透過型分析電子顕微鏡JEM-4010(日本電子)	PF	1日	12,000	機器利用	1	12,000	—
				技術支援	2	24,000	
				技術代行	5	60,000	
高分解能分析電子顕微鏡JEM-2010F(日本電子)	PF	1日	12,000	機器利用	1	12,000	—
				技術支援	2	24,000	
				技術代行	5	60,000	
ハイコントラスト透過型電子顕微鏡JEM-2010HC(日本電子)	PF	1日	3,000	機器利用	1	3,000	—
				技術支援	2	6,000	
				技術代行	10	30,000	
高分解能トップエントリー型透過電子顕微鏡JEM-2000EX II(日本電子)	PF	1日	3,000	機器利用	1	3,000	—
				技術支援	2	6,000	
				技術代行	10	30,000	

■ SEM

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
高分解能走査型分析電子顕微鏡(JSM-7001F)	PF	1時間	1,500	機器利用	1	1,500	—
				技術支援	5	7,500	
				技術代行	10	15,000	
高分解能走査型電子顕微鏡(JSM-7000F)	PF	1時間	1,500	機器利用	1	1,500	—
				技術支援	5	7,500	
				技術代行	10	15,000	
低真空走査型電子顕微鏡(JSM-6510FA)	PF	1時間	1,500	機器利用	1	1,500	—
				技術支援	5	7,500	
				技術代行	10	15,000	
低損傷走査型分析電子顕微鏡(SEM)JSM-7500FA(日本電子)	PF	1時間	1,500	機器利用	1	1,500	—
				技術支援	5	7,500	
				技術代行	10	15,000	

■AFM

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
走査型プローブ顕微鏡 L-Trace II (日立ハイテク)	PF	1画面	カンチレ バー持ち込 み:1000円、 カンチレ バー共用: 1400円	機器利用	1	基本単価×1	-
				技術支援	2	基本単価×2	
				技術代行	10	基本単価×10	

■XRD

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
超精密3次元構造解析装置 (XRD)Super-Lab(リガク)	PF	0.5日	12,000	機器利用	1	12,000	-
				技術支援	2	24,000	
				技術代行	5	60,000	
無機微小結晶構造解析装置 VariMax Dual((株)リガク)	PF	1時間	2,000	機器利用	1	2,000	1日最大12時間 まで課金し、それ 以上は課金しない。
				技術支援	2	4,000	
				技術代行	5	10,000	
有機高分子材料構造解析装置 Micro7HFM-AXIS VII((株)リガク)	自主	1時間	2,000	機器利用	1	2,000	1日最大12時間 まで課金し、それ 以上は課金しない。
				技術支援	2	4,000	
				技術代行	5	10,000	
高輝度In-plane型X線回折装置 Smart-Lab((株)リガク)	PF	0.5日	7,200	機器利用	1	7,200	-
				技術支援	2	14,400	
				技術代行	5	36,000	
表面構造評価用多機能X線回 折装置ATX-G Ultra18型(リガク)	PF	0.5日	7,200	機器利用	1	7,200	-
				技術支援	2	14,400	
				技術代行	5	36,000	
粉末X線回折装置Geigerflex(リ ガク)	自主	0.5日	1,200	機器利用	1	1,200	-
				技術支援	2	2,400	
				技術代行	15	18,000	
粉末X線回折装置SmartLab (3kW)(リガク)	PF	0.5日	7,200	機器利用	1	7,200	-
				技術支援	2	14,400	
				技術代行	5	36,000	
粉末X線回折装置SmartLab(K α1)(リガク)	PF	0.5日	7,200	機器利用	1	7,200	産学連携協定設 備
				技術支援	2	14,400	
				技術代行	5	36,000	

■電子状態分析装置

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
光電子分光表面電子構造測定 システム(XPS)R4000	自主	1日	10,000	機器利用	1	10,000	-
				技術支援	2	20,000	
				技術代行	不可	-	
電子スピン共鳴装置 (ESR)JES-FA300	PF	1日	15,000	機器利用	1	15,000	He使用時は1日 6,000円を加算。
				技術支援	2	30,000	
				技術代行	10	150,000	
多機能走査型X線光電子分光 分析装置(XPS)PHI 5000 VersaProbe(アルバックファイ)	PF	1時間	3,000	機器利用	1	3,000	1日最大12時間 まで課金し、それ 以上は課金しない。
				技術支援	2	6,000	
				技術代行	10	30,000	

■元素分析装置

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
超微量元素計測システム (SIMS)NanoSIMS 50L(アメテッ ク)	PF	1日	72,000	機器利用	1	72,000	準備・調整のため の測定は1日 10,000円
				技術支援	2	144,000	
				技術代行	5	360,000	

■光計測関連

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
CEP安定化フェムト秒再生増幅装置Legend Elite USP-HE-CEP/Evo-30(Coherent社)	自主	1日	32,000	機器利用	1	32,000	実験に必要な再生増幅器以外の全ての光学部品は基本的にユーザーが用意。
				技術支援	2	64,000	
				技術代行	不可	—	
分光エリプソメータM-2000U(J.A.Woollam)	PF	1日	5,000	機器利用	1	5,000	—
				技術支援	2	10,000	
				技術代行	10	50,000	

■電磁物性測定装置

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
極限環境下電磁物性計測装置PPMS-14LHatt(日本カンタム・デザイン)	PF	1日	20,000	機器利用	1	20,000	10T以上の磁場を発生する場合は課金額に20,000円(1日)を加算する。
				技術支援	2	40,000	
				技術代行	5	100,000	

■イオンビーム加工設備

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
透過型電子顕微鏡試料イオンビーム加工設備(FIB)JIB-4600F(日本電子(株))	PF	1時間	2,400	機器利用	1	2,400	—
				技術支援	2	4,800	
				技術代行	5	12,000	
CADデータ連動3次元機能融合デバイス評価用前処理システムXVision200TB(日立ハイテクノロジーズ)	PF	1時間	4,000	機器利用	1	基本単価積算×1	ガス銃:基本単価に2,000加算 SEM:1,000
				技術支援	2	基本単価積算×2	
				技術代行	10	基本単価積算×10	

■電気特性計測システム

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
環境制御マニュアルプローバステーション(東陽テクニカなど)	PF	1時間	1,500	機器利用	1	1,500	1日最大12時間まで課金し、それ以上は課金しない。
				技術支援	2	3,000	
				技術代行	5	7,500	

■ 試料作製装置

装置名称	区分	課金単位	基本単価	利用形態	課金係数	課金額	備考
クロスセクションポリッシャー (CP) JEOL SM-090010,090020	PF	1件	2,000	機器利用	1	2,000	—
				技術支援	2	4,000	
				技術代行	20	40,000	
精密イオンポリッシャー(PIPS) GATAN Model-691	PF	1日	3,000	機器利用	1	3,000	—
				技術支援	2	6,000	
				技術代行	10	30,000	
精密イオンポリッシャー(PIPS) JEOL EMD-12210	PF	1日	3,000	機器利用	1	3,000	—
				技術支援	2	6,000	
				技術代行	10	30,000	
イオンスライサー(IS) JEOL EM-09100IS	PF	1日	6,000	機器利用	1	6,000	—
				技術支援	2	12,000	
				技術代行	10	60,000	
クライオイオンスライサー (Cryo-IS) JEOL IB-09060CIS	PF	1日	6,000	機器利用	1	6,000	—
				技術支援	2	12,000	
				技術代行	10	60,000	
ミクロンマイスター マルトー MC-181MY	自主	1件	2,000	機器利用	1	2,000	—
				技術支援	2	4,000	
				技術代行	15	30,000	
低角用イオンミリングJEOL Model1010JT	自主	1件	2,000	機器利用	1	2,000	—
				技術支援	2	4,000	
				技術代行	15	30,000	
ウルトラマイクローム	PF	1件	50,000	機器利用	—	—	技術代行のみ。 利用者が試料を 包埋後、切り出し を依頼してください。
				技術支援	—	—	
				技術代行	1	50,000	
NanoMill MODEL1040 (Fischione Instruments)	自主	1時間	1,500	機器利用	1	1,500	—
				技術支援	2	3,000	
				技術代行	5	7,500	
真空蒸着装置	自主	—	—	機器利用	—	—	蒸着材料は利用者 が持参のこと。
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	
マルチプレップ研磨装置JEOL EM-ALLIED8	自主	—	—	機器利用	—	—	研磨紙等は利用者 が持参のこと。
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	
ディンプルグラインダーGATAN Model-656	自主	—	—	機器利用	—	—	回転子と研磨剤 は利用者が持参 のこと
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	
ウルトラソニックディスクカッ ターGATAN Model-601	自主	—	—	機器利用	—	—	刃は利用者が持 参のこと
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	
PECS	自主	—	—	機器利用	—	—	—
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	
オスミウムコーター	自主	—	—	機器利用	—	—	—
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	
低速切断装置(アイソメット)	自主	—	—	機器利用	—	—	ブレード、研磨剤 は利用者が持参 のこと
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	
ダイヤラップ	自主	—	—	機器利用	—	—	—
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	
ハンディラップ	自主	—	—	機器利用	—	—	研磨紙は利用者 が持参のこと
				技術支援	—	—	
				技術代行	—	—	